06;07;12 Гетероконтакт в системе полупроводник-мумие

© С.И. Драпак, В.В. Нетяга, Ю.И. Прилуцкий, М.О. Воробец, З.Д. Ковалюк

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, Черновицкое отделение, Черновцы E-mail: chimsp@unicom.cv.ua Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко

Поступило в Редакцию 29 апреля 2005 г.

Расширен диапазон материалов, которые могут использоваться в фоточувствительных структурах за счет привлечения органического вещества биологической природы — мумие. Исследованы вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики структуры *n*-InSe-мумие. Показано, что особенности спектрального распределения относительной квантовой эффективности исследуемой гетероструктуры находятся в корреляции со спектрами оптического поглощения пленок мумие, полученных из спиртового раствора.

Создание новых типов гетеропереходов на основе неорганических полупроводников и веществ различной природы является одним из актуальных направлений современной оптоэлектроники [1]. Недавно была обнаружена принципиальная возможность создания фоточувствительных гибридных структур, представляющих собой непосредственный гетероконтакт между неорганическим полупроводником и рядом веществ биологического происхождения [2–5]. В данной работе сообщается о первом наблюдении фотовольтаического эффекта, который возникает при контакте полупроводника (на примере InSe) с биологически активным веществом естественного происхождения — мумие.

Мумие (М), издавна известное своими целебными свойствами [6], представляет собой сложное по химической структуре вещество, которое образуется в трещинах скал, пустотах, нишах в виде пленок, корок и наростов смолоподобных масс с примесью песка и щебня. Очищенное от примесей и экстрагированное М — однородная масса эластичной консистенции, в состав которого входят как органические, так и неорганические компоненты. В М содержится 30 микроэлементов,

15

10 различных окисей металлов, а также комплекс органических и минеральных веществ.

Исследования электрических и фотоэлектрических свойств проводились на структурах, которые создавались нанесением пленок М из спиртового раствора на поверхность сколотых пластин слоистого полупроводника InSe по методике, описанной в [7]. В качестве исходного материала использовалось мумие очищенное, выпускаемое TOB "Биовит" (г. Бишкек, Республика Кыргизия; ТУ 9358-003-22588590-2001) в качестве пищевой добавки. Монокристаллы селенида индия были электрически однородными с концентрацией свободных электронов $n = 2 \cdot 10^{15}$ сm⁻³ и подвижностью основных носителей заряда перпендикулярно оси симметрии $c \ \mu_{\perp} \approx 700 \div 800 \text{ сm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ при T = 300 K. Толщина пленок М (плотность ~ 80 mg/cm³) на поверхности полупроводниковой подложки находилась в пределах $15 \div 30 \ \mu$ m, а их удельная проводимость σ составляла $10^{-7} \div 10^{-8} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. В качестве токовыводящих контактов со стороны полупроводника использовался In, а со стороны пленок органического вещества — Аg.

Измерения стационарных вольт-амперных характеристик (ВАХ) показали, что структуры n-InSe-M обладают четким выпрямляющим свойством: при напряжениях смещения $|V| = 2.5 \div 3 V$ прямой ток превышает обратный не менее, чем в $\sim 10^2$ раз. При этом направление пропускания соответствовало отрицательной полярности внешнего источника тока на полупроводнике. Типичная ВАХ одной из таких структур представлена на рис. 1, a (кривые 1, 2). Начальные участки прямых ветвей ВАХ исследуемых структур *n*-InSe-M при напряжении $V \leq 2.2 \div 2.5 \,\mathrm{V}$ (рис. 1, кривая *I*) с учетом последовательного дифференциального сопротивления при T = 287 К имеют три участка: в области низких смещений ($V \leq 0.2 \text{ V}$) $I = I_{01} \exp(eV/nkT)$, где диодный коэффициент n = 2; при $0.2 \le V \le 1.2 \div 1.4$ V $I = I_{02} \exp(\alpha V + \beta T)$, где α и β — параметры, не зависящие от напряжения и температуры, и при $1.2 \div 1.4 \leq V \leq 2.2 \div 2.5 V$ $I = I_{03} \exp(eV/nkT)$, где $n \cong 1$. Подобная зависимость тока от напряжения характерна для гетеропереходов, соответствующих модели Андерсона, на основе неорганических полупроводников, для которых в общем случае прямой ток являлся суммой рекомбинационного в области пространственного заряда (ОПЗ) Igr, туннельного I_t и надбарьерного I_d [8]. Однако в нашем случае при изменении температуры в диапазоне T = 220-303 K зависимость I = f(V) сдвигается параллельно. I_0 на всех трех участках в области прямых смещений до $V \approx 2.2 \div 2.5 \,\mathrm{V}$ меняется с температурой по



Рис. 1. Прямая (1,3) и обратная (2) ветви стационарной вольт-амперной характеристики структуры *n*-InSe-M. Площадь пленки M на поверхности полупроводника $S_{\rm M} = 0.45 \, {\rm cm}^2$, металлического контакта со стороны органического вещества $S_{\rm Ag} = 0.08 \, {\rm cm}^2$. $T = 287 \, {\rm K}$.

закону $I_0 \sim \exp(E_a/kT)$, а значение энергии активации для различных образцов колебалось в пределах $E_a = 0.32 \div 0.34$ eV. С другой стороны, начальные участки прямых ветвей BAX структуры *n*-InSe-M сходны с зависимостью I = f(E) для газов [9], где E — напряженность электрического поля. Согласно [10], органические вещества, обладающие полупроводниковыми свойствами, больше напоминают молекулярный газ, чем твердые тела. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что начальные участки прямых ветвей BAX в нашем случае отображают процесс токопрохождения в ОПЗ, полностью смещенной в органическое вещество. Из рис. 1 (кривая 3), видно, что для структур *n*-InSe-M прямой ток при V > 4 V линейно зависит от напряжения

$$I = (V - V_0)/R_0,$$
 (1)

где напряжение отсечки $V_0 \cong 2.5 \,\mathrm{V}$, а остаточное сопротивление $R_0 \sim 10^4 \,\Omega$ при $T = 287 \,\mathrm{K}$. В области небольших обратных смещений $(|V| < 0.3 \div 0.5 \,\mathrm{V})$ ВАХ исследуемых структур изменялась от образца

к образцу, что позволяет сделать предположение о том, что в этом диапазоне смещений доминирующая роль принадлежит токам утечки. При увеличении обратного смещения ВАХ описывается выражением

$$I \sim (\varphi_0 - eV)^{1/2},$$
 (2)

что характерно для генерационно-рекомбинационных процессов в ОПЗ [8]. Причем с увеличением температуры диапазон напряжений, при которых выполняется (2), увеличивается. Так, например, при T = 243 К ВАХ структур *n*-InSe-M описывается уравнением (2) в диапазоне $|V| \approx 0.5 \div 3$, а при T = 303 К — в диапазоне $0.5 \div 12$ V. При увеличении смещения обратный ток подчиняется степенной зависимости $I \sim V^2$, что характерно как для туннелирования, так и для токов, ограниченных пространственным зарядом [11].

Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) системы *n*-InSe-M, измеренные в диапазоне частот $\omega = 10 \div 30 \,\mathrm{kHz}$, зависели от частоты измерения, что характерно для структур на основе неорганических полупроводников с большим остаточным сопротивлением [12], и были близки к линейным в координатах $C^{-2}-V$ в диапазоне обратных смещений 0 ÷ 3 V. Однако определение величины барьерного потенциала по методике [12] (аппроксимация значений напряжений отсечек V_b , полученных при различных частотах, зависимостью V_b (ω) $-\omega^2$ к $\omega = 0$) давало неоднозначный результат. В то же время значение напряжения отсечек C-V зависимостей, измеренных при $\omega = 10 \div 30 \,\mathrm{kHz}$ и перестроенных в координатах $C^{-3}-V$, давало одну и ту же величину $V_b = 2.63$ V, которая находилась в хорошем согласии с V_0 , определенной из ВАХ. Поскольку растворы М можно рассматривать как суспензию или эмульсию [13], вполне вероятно, что типичная для плавных *p*-*n*-переходов линейная зависимость $C^{-3} = f(V)$ является следствием организации структуры пленок органического вещества на поверхности полупроводника в процессе испарения растворителя. Увеличение частоты тестирующего сигнала до $\omega = 0.5 \div 1 \,\text{MHz}$ приводит не к уменьшению C структуры *n*-InSe-M (как это имеет место при увеличении ω до 30 kHz), а к ее увеличению, что свидетельствует о дисперсии диэлектрических коэффициентов пленок М в этом диапазоне частот.

При освещении полученных структур естественным излучением обнаружен фотовольтаический эффект, при котором на полупроводниковой подложке возникает отрицательное фотонапряжение, что коррелирует с направлением пропускания BAX гетероструктур *n*-InSe-M.



Рис. 2. Спектральные зависимости относительной квантовой эффективности фотопреобразования $\eta(h\nu)$ гетероструктуры *n*-InSe-M (1 — освещение со стороны пленок органического вещества, 2 — со стороны полупроводника) и коэффициента оптического пропускания T^* пленок М толщиной $d = 70 \,\mu$ m. T = 287 K.

Причем знак фотонапряжения не изменяется при изменении длины волны и локализации светового зонда на поверхности исследуемых структур, а величина фотоответа преобладает при освещении структур со стороны пленки М.

Типичная спектральная зависимость относительной квантовой эффективности фотопреобразования $\eta(h\nu)$, определенной как отношение фототока к числу падающих фотонов, гетероструктуры *n*-InSe-M при освещении ее со стороны пленок органического вещества, приведена на рис. 2 (кривая *I*). Эта зависимость имеет характерный для полупроводниковых гетеропереходов вид. Крутизна длинноволнового экспоненциального края фоточувствительности в полученных структурах $s = \delta(\ln \eta)/\delta(h\nu) \approx 80 \text{ eV}^{-1}$ соответствует прямым оптическим переходам в полупроводнике, а энергетическое положение излома при энергии фотонов $h\nu = 1.2 \text{ eV}$ согласуется со значением ширины запрещенной зоны InSe. При этом в спектре η в области края фундаментального

поглощения полупроводниковой подложки присутствует узкий пик, характерный для фотопроводимости слоистых полупроводников A³B⁶ и обычно приписывается экситонным эффектам. Рост фоточувствительности при увеличении энергии фотонов $h\nu \approx 2.3 \,\mathrm{eV}$ вызван увеличением коэффициента поглощения света в селениде индия, что приводит к улучшению собирания и разделения генерированных фотоносителей на барьере ГК. Уменьшение фоточувствительности системы n-InSe-M, которое проявляется при $hv > 2.3 \, \text{eV}$, а также непродолжительные участки ее увеличения при $h\nu \approx 2.6, 2.9$ и $3.2 \,\mathrm{eV}$ находятся в качественном соответствии со спектральной зависимостью коэффициента оптического пропускания пленок органического вещества (рис. 2, кривая 3). По этой причине коротковолновый спад $\eta(hv)$ может быть связан с поглощением излучения в широкозонной компоненте структуры, через которую излучение поступает в активную область гетероструктуры. При освещении таких структур со стороны полупроводниковой подложки эффективность фотопреобразования существенно падает и имеет узкоселективный характер с максимумом вблизи ширины запрещенной зоны InSe (рис. 2, кривая 2). Это объясняется резким ростом оптического поглощения в полупроводниковой пластине при наступлении прямых межзонных переходов и удалением слоя фотогенерированных носителей от активной области структуры на расстояние, которое превышает длину диффузионного смещения фотодырок в InSe.

Таким образом, контакт полупроводника с мумие, как и в случае других веществ биологической природы [2–5], обнаруживает фотовольтаический эффект, который может использоваться при разработке широкополосных фотосенсоров оптического излучения.

Список литературы

- [1] Алфёров Ж.И. // ФТП. 1998. Т. 32. В. 1. С. 3-18.
- [2] Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х. // ФТП. 1997. Т. 31. В. 2. С. 129–132.
- [3] Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шпунт В.Х. // ЖТФ. 2000. Т. 70. В. 2. С. 114-117.
- [4] Драпак С.И., Ковалюк З.Д. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 6. С. 73-78.
- [5] Драпак С.И., Орлецкий В.Б., Фотий В.Д., Ковалюк З.Д. // Прикладная физика. 2004. Т. 11. В. 2. С. 73–76.
- [6] Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки: В 2 т. Ташкент: Фан, 1982. Т. 2. 832 с.
- [7] Драпак С.И., Орлецкий В.Б., Ковалюк З.Д., Нетяга В.В. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 20. С. 69–76.

- [8] Шарма Б.Л., Пурохит Р.К. Полупроводниковые гетеропереходы. М.: Сов. радио, 1979. 230 с.
- [9] Богородицкий Н.П., Волокобинский Ю.М., Воробьев А.А., Тареев Б.М. Теория диэлектриков. М.–Л.: Энергия, 1965. 344 с.
- [10] *Силиныш Э.А., Тауре Л.Ф.* Органические полупроводники. М.: Знание, 1980. 64 с.
- [11] Sze S.M. Physics of Semiconductor Devices. N.Y.: Willey-Intersci., 1981. 456 p.
- [12] Бланк Т.В., Гольдберг Ю.А., Калинина Е.В. и др. // ФТП. 2001. Т. 35. В. 5. С. 550–553.
- [13] Киселева Т.Л., Фролова Л.Н., Баратова Л.А., Галина С.И. // Медикофармацевтический вестник. 1996. В. 6. С. 38–43.